

Ethyl Silicate 로부터 Silicon Nitride 의 合成(II) : 窒化反應에서 添加劑의 影響

吳一煥 * · 朴金喆

漢陽大學校工科大學 無機材料工學科

*大邱工業專門大學 磚業科

(1988년 8월 18일 접수)

Synthesis of Silicon Nitride from Ethyl Silicate(II) :
Effect of Additive on the Nitridation of Silicon Nitride

IL - Hwan O* and Keum - Churl Park

Dept. of Inorganic Materials Eng. Hanyang Univ.

*Dept. of Ceramic DaeKu Technical Junior Colledge

(Received August 18, 1988)

要 著

Ethyl Silicate 의 加水分解로 生成된 單分散球狀실리카(平均粒徑 0.46 μm)와 Carbon/SiO₂의 mole 比가 10 이 되게 Carbon black 을 加한 混合物에 各種의 添加劑를 加하여 窒素流入下에 1450°C에서 窒化反應시켰다.

그 結果 添加量은 大體로 2.0 wt%以下에서 窒化反應에 效果的인 것으로 여겨진다.

1450°C에서 1시간동안 窒化反應을 시키면 添加劑는 窒化反應을 促進시키고 β-Si₃N₄의 生成을 促進시키나 長時間 窒化反應시키면 促進效果가 減少되고 α/β 比가 크게 나타났다.

α-Si₃N₄를 添加劑로 添加하면 生成된 窒化物의 結晶相은 α 相이고, 窒化率도 增大되어 生成된 結晶의 크기가 작아지고 있으며 轉移元素를 添加하면 窒化物은 whisker 狀 結晶을 이루었다.

添加劑의 種類나 反應時間의 差에 따라서 生成되는 α-Si₃N₄의 格子定數의 값은 差異가 생기나 β-Si₃N₄의 格子定數의 값은 別差異가 없었다.

ABSTRACT

Mixtures of very small amounts of additive, carbon and silica(about 0.46 μm)which synthesized by the hydrolysis of ethyl silicate, the molar ratio of SiO₂/C was fixed to 1/10, was nitrided at 1450°C.

It was considered that the optimum amount of additive to promote the nitridation reaction was below 2.0 wt%.

By the addition of additive, the nitridation reaction was promoted and formation of β-Si₃N₄ was promoted

at 1450°C for 1 hour, but, the nitridation reaction was decreased and the ratio of α/β of Si_3N_4 was increased at 1450°C for 5 hours.

The crystal phase was α phase and the nitridation reaction was promoted and the particle size of silicon nitride was become smaller by the addition of $\alpha-\text{Si}_3\text{N}_4$, but, silicon nitride of whisker-like form was produced by the addition of transition elements.

There was a difference in the lattice constants of $\alpha-\text{Si}_3\text{N}_4$, but no difference in its of $\beta-\text{Si}_3\text{N}_4$ according to kinds of added substance and reaction time.

1. 緒論

Si_3N_4 의 合成方法中 現在 工業的으로 重要시되고 있는 製法의 一種인 Silica의 Carbon과 窒素가스에 의한 還元窒化法^{1)~10)}에서 筆者는 Silica 원으로 알록시드의 加水分解生成物을 使用한 경우에 關하여 報告한 바 있다.¹²⁾

本研究는 ethyl silicate의 加水分解로 單分散球狀의 Silica 粒子가 生成되는 條件¹³⁾에서 Carbon/SiO₂ mole 比가 10이 되게 Carbon black을 混在시켜 加水分解反應을 일으킨 混合物에 各種의 添加劑를 加하여 還元窒化反應을 시켰을때 窒化生成物의 特性을 調査하였다.

2. 實驗

2-1. 窒化反應

Ethyl silicate의 加水分解溶液의 組成은 前報¹²⁾와 같이 $\text{Si}(\text{O C}_2\text{H}_5)_4$ 0.2 mol/l, H_2O 18.40 mol/l, NH_3 1.40 mol/l, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 10.12 mol/l(生成 Silica의 平均粒徑이 0.46 μm)의 比率이 되게하고 여기에 Carbon/SiO₂의 mole 比가 10이 되게 Carbon black을 加하여 Rotary evaporator에서 加水分解, 混合 및 乾燥가 되게 하였다. 여기에 0.5~5.0 wt%가 되게 添加劑를 加하여 充分히 混合한 다음 109 kg/cm²의 壓力下에서 成形하고 管狀爐에서 2.2 cm/sec의 流速으로 N_2Gas 를 流入시켜 窒化시켰다. 이때 成形된 試片의 크기는 6.6 mm × 12.8 mm ϕ 이며 이것은 alumina boat에 담겨져 內徑 64 mm의 mullite質 爐芯管內에 놓아도록 하였다. 升溫速度는 0°C~1200°C는 30°C/min, 1200°C~1450°C는 5°C/min이었고 1450°C에서 1時間 및 5時間 反應시킨後 自然冷却시켰으며 700°C까지는 窒素 Gas를 流入시킨 狀態에서 冷却하였다.

2-2. 添加劑

添加劑는 特級試藥의 純度를 갖는 20種을 使用하였다.

2-3. 定量分析

窒化反應後의 試片은 空氣中에서 650°C에서 5時間 加熱하여 残留 Carbon을 除去한 다음 X-線回折分析으로 定量하였다. X-線回折分析 장치는 Rigaku社製로, Filter Ni, Target CuK_α, Slit 1°~1°~0.15 mm, 管電壓, 管電流 40 kV, 30 mA, Full scale 8000 cps, scanning speed 2°/min, chart speed 20 mm/min이었다. 標準物質로 使用한 $\alpha-\text{Si}_3\text{N}_4$ 는 昭和電工(株)製 98.5%, 와 Toyo Soda 製 98.4%의 것이며, $\beta-\text{Si}_3\text{N}_4$ 는 昭和電工(株)製 100%였고, 內部標準物質로 CaF_2 를 10 wt% 添加하여 檢量線을 作成하고 定量하였다. 檢量線을 作成하고 定量할 때 結晶의 方向性의 영향을 最小化하기 위해서 Gazzar와 Messier¹³⁾가 제시한 구조관제인자를 적용시켰다.

2-4. 粒子의 形狀 및 粒徑

粒子의 形狀 및 粒徑은 SEM으로 관찰 및 측정을 하였다.

2-5. 格子定數

X-線回折分析條件에서 scanning speed는 1°/min로, chart speed는 40 mm/min로 하였다. $\alpha-\text{Si}_3\text{N}_4$ 는 (201), (210)面에서, $\beta-\text{Si}_3\text{N}_4$ 는 (101), (210)面에서 面間隔 d를 求하고 Hexagonal의 面間隔 d와 格子定數의 關係인 式 (1)에

$$\frac{1}{d^2} = \frac{4}{3} \left(\frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} \right) + \frac{I^2}{c^2} \quad \dots \dots \dots (1)$$

代入하여, a,c를 계산한 다음 Unit volume은 $\sin 60^\circ \times c$ 式의 關係에서 求하였다.

3. 結果 및 考察

Ethyl Silicate의 加水分解生成物과 Carbon black 混合物에 添加劑를 添加하여 1450°C에서 1時間 및 5時間 窒素氣流下에 窒化反應시킨 結果는 다음과 같다.

3-1. 窒化率 및 結晶相

(1) 添加劑의 添加量

豫備實驗에서 窒化反應의 促進效果가 큰 것으로 認知된 添加成分中, α - Si_3N_4 , MgO 및 CaO 의 3種類에 對하여 이들의 添加量을 變化시켰을 때 窒化硅素의 生成量關係를 Fig. 1에 나타냈다. Fig. 1에서 알 수 있듯이 添加劑의 種類에 따라서 窒化反應에 미치는 效果가 다르다. α - Si_3N_4 를 添加할 경우에는 添加量의 變化에 따른 窒化反應의 差異가

僅少하였다. MgO 를 添加할 경우에는 α - Si_3N_4 의 生成量은 添加量 2.0 wt%에서 極大값을 나타내고 있고 β - Si_3N_4 의 生成量은 添加量이 增加함에 따라서 增大되는 경향을 나타냈다. 또한, CaO 를 添加할 때는 添加量이 增加함에 따라서 α - Si_3N_4 의 生成量은 減少되었고, β - Si_3N_4 의 生成量은 增大되는 경향을 나타내었다. 上의 結果로 보아, 添加

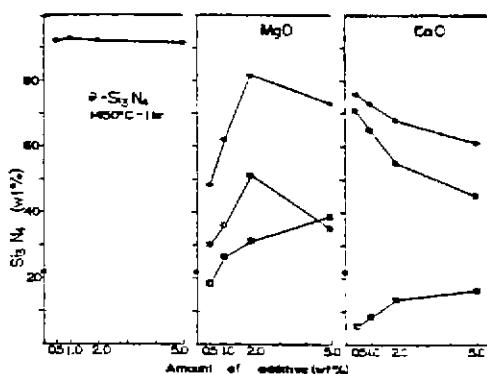


Fig. 1. Relation between reaction products and amount of various additive.

● : α - $\text{Si}_3\text{N}_4 + \beta$ - Si_3N_4 , ○ : α - Si_3N_4 , □ : β - Si_3N_4

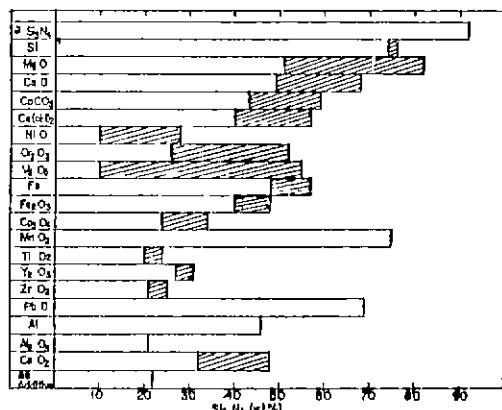


Fig. 2. Effect of various additive (2%) on production of silicon nitride at 1450°C for 1 hour. □ : α - Si_3N_4 , ■ : β - Si_3N_4

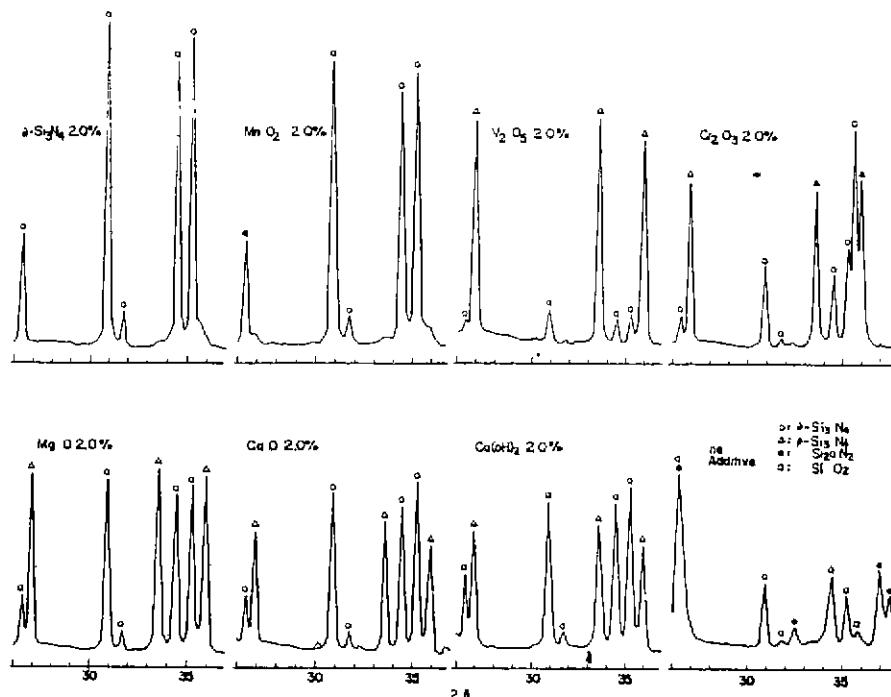


Fig. 3. XRD patterns of nitriding products formed at 1450°C for 1 hour.

添加劑의 添加量은 大體로 2.0 wt% 以下에서 效果的인 것으
로 여겨진다.

(2) 添加劑의 種類 및 反應條件

各種 添加劑를 各各 2.0 wt% 씩 添加하여 1450°C에서 1
時間동안 窒化反應시킨 후 生成窒化珪素를 結晶相別로 定量
한 結果를 Fig. 2에 나타내었고 그 X線回折圖는 Fig. 3과

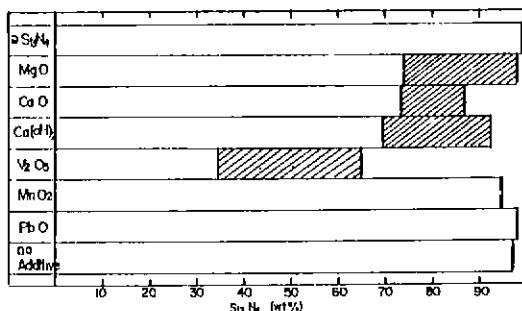


Fig. 4. Effect of various additive(2 wt%) on production of silicon nitride at 1450°C for 5 hours.

□ : $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$, ■ : $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$

같다 Fig. 2를 보면 窒化珪素의 生成率은 添加劑의 種類에
따라서 현저하게 다르며 本實驗에서 使用한 添加劑들은
 Al_2O_3 를 除外하고는 窒化珪素의 生成率을 增加시키는 效果
를 나타내고 있다. 窒化反應效果가 큰것부터 작은것의 순
서를 보면 $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4 > \text{MgO} > \text{Si} > \text{MnO}_2 > \text{PbO} > \text{CaO} >$
 $\text{CaCO}_3 > \text{Fe} > \text{Ca}(\text{OH})_2 > \text{V}_2\text{O}_5 > \text{Cr}_2\text{O}_3 > \text{Fe}_2\text{O}_3 > \text{CeO}_2 >$
 $\text{Al} > \text{Co}_3\text{O}_4 > \text{Y}_2\text{O}_3 > \text{NiO} > \text{ZrO}_2 > \text{TiO}_2$ 으로 나타나고 있으
며 이를 添加劑가 效果的인 것은 SiO 의 生成을 容易하게
하기 때문인 것으로³⁾ 생각되고, 窒化反應에 Seed로서 役割³⁾한 것으로 보여진다.

添加劑의 種類에 따라서 生成하는 窒化珪素의 結晶相에
미치는 效果도 相異하다. 前報의 實驗에서 Ethyl Silicate
의 加水分解 生成物과 C/SiO_2 mole 比가 10 이 되게
Carbon black을 混合하여 1350°~1500°C間에서 窒化反應
시킨 望化生成物의 結晶相은 $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ 이였다.¹²⁾ 그리고
本實驗에서 添加劑로 $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$, MnO_2 , PbO , Al 및 Al_2
 O_3 를 添加시켜서 窒化反應시킨 生成物의 結晶相도 $\alpha\text{-Si}_3$
 N_4 이다. 그러나, 그 以外의 添加劑를 添加하여 窒化反應시

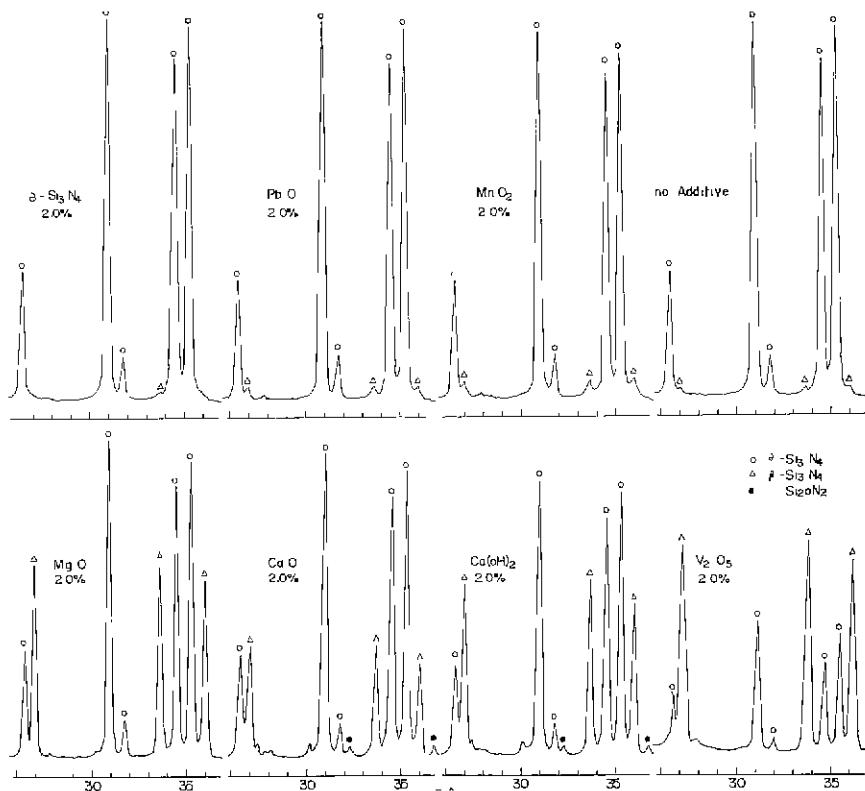


Fig. 5. XRD patterns of nitriding products formed at 1450°C for 5 hours.

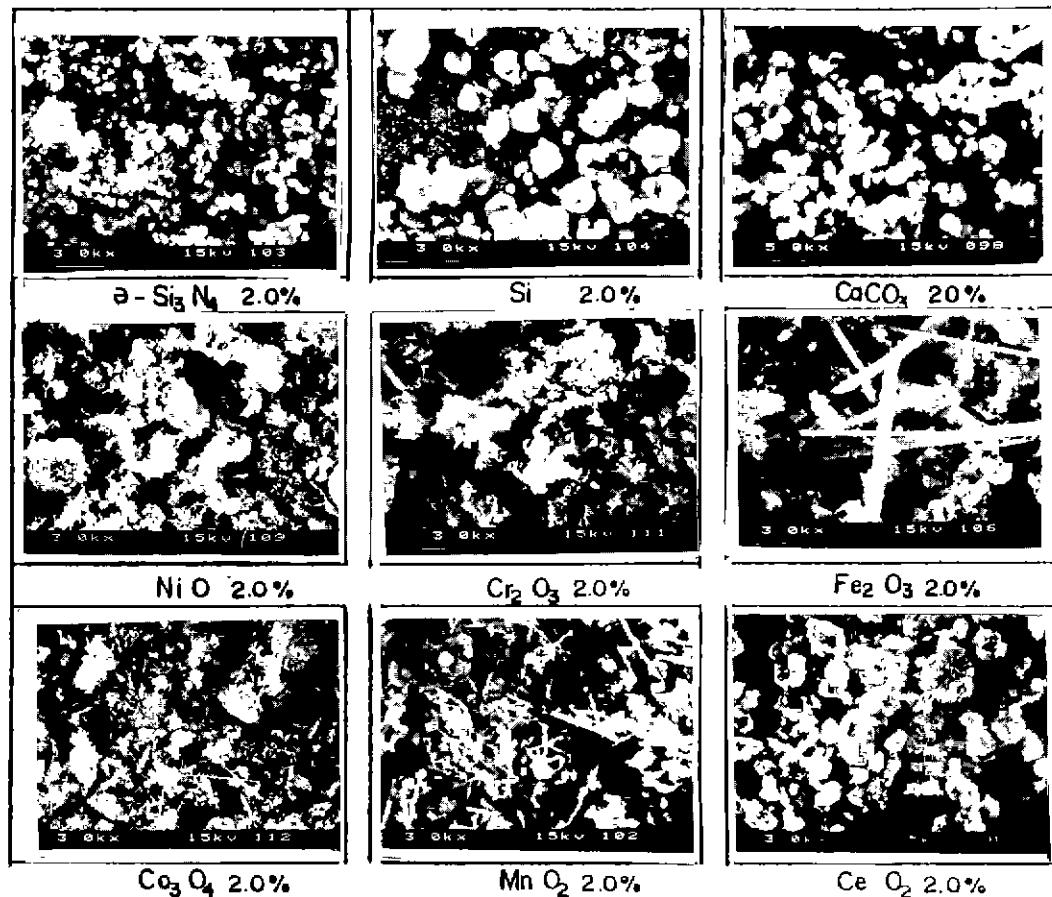


Fig. 6. The SEM photographs of silicon nitride crystals formed with various additives at 1450°C for 1 hour.

진生成物의 結晶相은 α - Si_3N_4 와 β - Si_3N_4 로서, 添加劑가 β - Si_3N_4 의 生成反應을 促進시키고 있음을 알 수 있다.

Fig. 2에서 窒化反應生成物中 β - Si_3N_4 의 生成率이 높은 것부터 낮은 것의順序로 添加劑를 열거하면 $\text{V}_2\text{O}_5 > \text{NiO} > \text{Cr}_2\text{O}_3 > \text{MgO} > \text{CeO}_2 > \text{Ca}(\text{OH})_2 > \text{Co}_3\text{O}_4 > \text{CaO} > \text{CaCO}_3 > \text{Fe}_2\text{O}_3 > \text{TiO}_2 > \text{ZrO}_2 > \text{Fe} > \text{Y}_2\text{O}_3 > \text{Si}$ 의順으로 되어 있다.

1450°C 1시간의反應에서 窒化反應의 促進效果가 큰添加劑 α - Si_3N_4 , MgO , MnO_2 , PbO , CaO , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 및 V_2O_5 를 選定하고 이를 2.0 wt% 添加하여 1450°C에서 5時間 窒化反應시켰을 때 生成된 窒化珪素를 結晶相別로 定量한結果는 Fig. 4와 같고 그 X線回折圖는 Fig. 5와 같다. Fig. 4를 보면 長時間 窒化反應시키는 경우는 添加劑로서

效果가 거의 없음을 알 수 있다. 即添加劑 α - Si_3N_4 , MgO 및 PbO 를 添加시킨 경우에는 添加하지 않으려 보다 窒化率이 약간 높게 나타나고 있으나, 그以外의 添加劑의 경우는 窒化率이 오히려 낮게 나타났으며 生成된 窒化珪素中의 β - Si_3N_4 의 存在比率도減少되는 경향을 나타내고 있다. 窒化反應時間이 길어짐에 따라 α/β 比가 커지는 것은 前報¹²⁾의 實驗에서와 같이 α 相의 結晶成長쪽이 현저하기 때문인 것으로 생각된다.¹⁾

以上의結果에서 添加劑를 加하여 1450°C에서 1時間 窒化反應을 시켰을 때는 窒化反應을 促進시키는데 效果의이고 β - Si_3N_4 의 生成을 促進시키나, 長時間 窒化反應 시킨 α - Si_3N_4 , MgO 및 PbO 以外는 窒化反應을 억제시키며, α/β 比가 커지는 현상을 나타냈다.

3-2. 窒化物의 形狀 및 크기

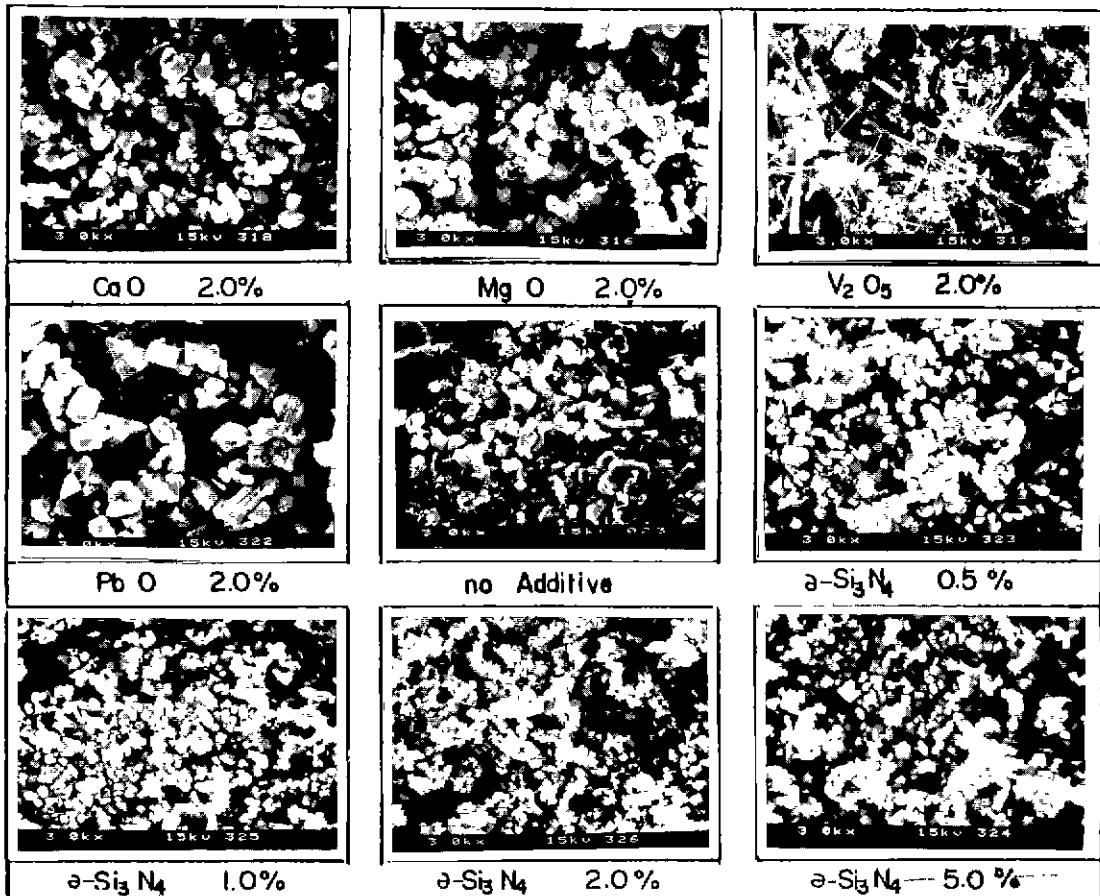


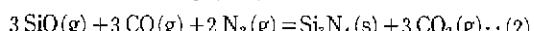
Fig. 7. The SEM photographs of silicon nitride crystals formed with various additives at 1450°C for 5 hours.

添加剤가生成되는 窒化珪素의 結晶形狀에 미치는 영향을 檢討하기 위해서 反應生成物을 SEM으로 관찰한結果는 Fig.6 및 Fig.7과 같다.

窒化反應率을 높이는 α - Si_3N_4 , MgO, Si, PbO, CaO, CaCO_3 및 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 등을 添加시켰을 때生成된 窒化物의 結晶은 六角柱狀을 나타내고 있다. 그리고 α - Si_3N_4 를 添加한 경우는 Fig.7에서와 같이 添加量이增加함에 따라서生成된 窒化物의 結晶의 平均粒徑이 2.3 μm (無添加)에서 0.9 μm (5.0 wt%)로 점차 작아지고 있다. 이는 α - Si_3N_4 가 結晶核을 生成하는 役割을 하기 때문인 것으로 窒化反應의 促進效果가 큰 添加劑는 結晶核의 生成쪽에 우선적으로作用하는 것으로 생각된다.¹⁹⁾ 따라서, α - Si_3N_4 의 添加는 窒化物의 生成率을 增大시키고 生成된 窒化物의 結晶相은 α -相이며, 結晶의 크기를 작게하고 있으므로 Seed로

서의 役割로 매우 效果的이라고 생각된다.

轉移元素를 添加하여 窒化反應시킬 때 生成된 窒化物의 結晶은 whisker 狀을 이루고 있으며, Fe 및 Fe_2O_3 를 添加할 경우는 whisker 狀의 直徑이 1.5 μm 에 이르고 있다. 轉移元素의 添加는 whisker 狀結晶을 生成하고 있으므로 이는 結晶成長에 기여하고 있음을 알 수 있고 이때 生成反應式은 다음과 같이 생각된다.²⁰⁾



3-3. 格子定數

本實驗에서 窒化反應으로 生成된 α - Si_3N_4 와 β - Si_3N_4 의 格子定數 測定值와 既히 報告된 文獻上의 値을 比較하면 Table.1과 같다.

本實驗에서 測定된 α - Si_3N_4 의 Axis ratio(c/a)는 1450°C - 1 hr 반응에선 0.727, 1450°C - 5 hrs 반응에선

Table 1. Lattice constants of Si_3N_4 .

Phase	Component of additive	Reaction temperature and time	Lattice constants		Axis ratio c/a	Unit volume (Å³)	
			a(Å)	c(Å)			
$\alpha - \text{Si}_3\text{N}_4$	V_2O_5	"	7.759 (± 0.005)	5.636 (± 0.005)	0.726	293.6	This work
	Al and Al_2O_3	"	7.772 (± 0.005)	5.651 (± 0.005)	0.727	295.6	
	other additive	1450 °C - 1hr	7.761 (± 0.005)	5.639 (± 0.005)	0.727	294.1	
	no additive	"	7.761 (± 0.005)	5.639 (± 0.005)	0.727	294.1	
	$\alpha - \text{Si}_3\text{N}_4$	1450 °C - 5hrs	7.757 (± 0.005)	5.627 (± 0.005)	0.725	293.2	This work
	MgO	"	7.761 (± 0.005)	5.625 (± 0.005)	0.725	293.4	
	CaO and $\text{Ca}(\text{OH})_2$	"	7.758 (± 0.005)	5.631 (± 0.005)	0.726	293.5	
	V_2O_5	"	7.744 (± 0.005)	5.606 (± 0.005)	0.724	291.1	
$\beta - \text{Si}_3\text{N}_4$	MnO_2	"	7.761 (± 0.005)	5.639 (± 0.005)	0.727	294.1	This work
	PhO	"	7.761 (± 0.005)	5.632 (± 0.005)	0.726	293.8	
	no additive	"	7.758 (± 0.005)	5.631 (± 0.005)	0.726	293.5	
	$\text{SiO}_2 - \text{B}$		7.771 (± 0.003)	5.620 (± 0.003)	0.723	293.9	Reference 4)
	py- Si_3N_4		7.752 (± 0.002)	5.622 (± 0.002)	0.725	292.6	16)
			7.755 (± 0.005)	5.616 (± 0.005)	0.724	292.5	14), 17)
	whole additive	1450 °C - 1hr	7.615 (± 0.005)	2.911 (± 0.005)	0.382	146.2	This work
	MgO	1450 °C - 5hrs	7.611 (± 0.005)	2.910 (± 0.005)	0.382	146.0	
	CaO and $\text{Ca}(\text{OH})_2$	"	7.611 (± 0.005)	2.909 (± 0.005)	0.382	145.9	
	V_2O_5	"	7.595 (± 0.005)	2.903 (± 0.005)	0.382	145.0	
	MnO_2	"	7.615 (± 0.005)	2.911 (± 0.005)	0.382	146.2	
			7.606 (± 0.005)	2.907 (± 0.003)	0.382	145.6	Reference 14), 17)

0.725 - 0.726으로 他報文의 값에 비하여 약간 큰 값을 나타내고 있다. unit volume은 또한 他報文의 값보다 약간 크게 나타내고 있고 1450°C - 1 hr反應에서 窒化率이 억제되는 Al_2O_3 를 添加할때는 添加劑가 없을 경우보다 unit volume이 커지고 있고, $\beta - \text{Si}_3\text{N}_4$ 의 生成率을 현지하게 촉

진시키는 V_2O_5 를 添加할때는 작아지고 있다. 또한 反應時間이 길어짐에 따라서 c/a 값이 僅少하게 작아지고 있고 unit volume도 작아지고 있다. 이와같이 反應時間 및 添加劑의 種類에 따라서 $\alpha - \text{Si}_3\text{N}_4$ 의 Axis ratio(c/a) 및 unit volume의 差가 나는 것은 $\alpha - \text{Si}_3\text{N}_4$ 의 構造中에 固溶되는

酸素量의 差에 기인되는 것으로 생각된다.¹⁴⁾

β - Si_3N_4 의 Axis ratio(c/a) 및 unit volume 은 他報文의
값과 類似한 값을 나타내고 있다.

4. 結 論

Ethyl silicate 의 加水分解로 生成된 單分散球狀실리카(平均粒徑 0.46 μm)와 Carbon/SiO₂의 mole 比가 10 이 되게 Carbon black 을 加한 混合物에 各種의 添加劑를 加하여 窒素流入下에 1450°C에서 窒化反應시킨 結果는 다음과 같다.

1. 添加量은 大體로 2.0 wt% 以下에서 窒化反應에 效果의 有 것으로 여겨진다.

2. 1450°C에서 1時間동안 窒化反應을 시켰을때는 添加劑는 窒化反應을 促進시키고, β - Si_3N_4 의 生成을 促進시키나 長時間동안 窒化反應시키면 促進效果가 減少되고 α/β 比가 커지는 현상을 나타냈다.

3. α - Si_3N_4 를 添加劑로 添加하면 生成된 窒化物의 結晶相은 α 相이고, 窒化率도 增大되어 生成된 結晶의 크기가 작아지고 있다. 轉移元素을 添加하면 窒化物은 whisker 狀 結晶을 이루었다.

4. 添加劑의 種類나 反應時間의 差에 따라서 生成되는 α - Si_3N_4 의 格子定數의 値은 差異가 생기나 β - Si_3N_4 의 格子定數의 値은 別差異가 없었다.

後 記

本研究 即 第1報(前報) 및 第2報는 韓國科學財團의 借款研究費 支援으로 進行되었으며 그 配慮에 感謝드립니다.

REFERENCE

1. Soichiro Motoi, Shozo Hidaka, "Synthesis of Silicon Nitride from Silica", "Denki Kagaku" 43, (1), 33~38 (1975).
2. Soichiro Motoi, "Nitridation of Molded Silica - Carbon Mixtures", "Denki Kagaku", 181~186 (1977).
3. Hajime Saito, Takashi Hayashi and Kazunori Miura, "Vapor Phase Growth of Si_3N_4 Whisker by Nitridation of the SiO₂ - C - Na₃AlF₆ System", "J. chem of Japan" No 9, 1371~1377 (1981).
4. Y. Fukushige, T. Nagae, K. Shimada and A. Kato", Reductive Nitridation of Cristobalite with Carbon in N₂ Atmosphere", "Yogyo - Kyokai - shi" 92, (4) 179~187 (1984).
5. M. Mori, H. Inoue and T. Ochiai, "Preparation of Silicon Nitride Powder from Silica", Progress in Nitrogen Ceramics, Edited by F. L. Riley, 149~156 (1983).
6. K. Komeya, H. Inoue, "Synthesis of the α form of Silicon Nitride from Silica", "J. Mat. Sci" (10) 1243~1246 (1975).
7. A. Hendry, K. H. Jack, "The preparation of Silicon Nitride from Silica", Special Ceramics 6, Ed by P. Popper, Brit Ceram. R. A. Stoke-on-Trent, 199~209 (1975).
8. Hiroshi Inoue, Kaisutoshi Komeya and Akihiko Tsuge, "Synthesis of silicon Nitride Powder from silica Reduction", "Communications of the American Ceramic Society", C-205 (1982).
9. Shi Chang Zhang, W. Roger Cannon, "Preparation of Silicon Nitride from Silica", "J. Am. Ceramic Society", 67, (10) 691~695 (1984).
10. A. Szweda, A. Hendry and K. H. Jack, "The Preparation of Silicon Nitride from Silica by Sol-Gel Processing", Special Ceramics 7 Ed. by P. Popper, B. C. RA Stoke-on-Trent 107~118 (1981).
11. 吳一煥, 朴金喆, "Ethyl silicate 의 加水分解에 의한 單分散 Silica 微粒子의 合成(I)", "요업학회지" 24, (5), 500~506 (1987).
12. 吳一煥, 朴金喆, "Ethyl silicate로 부터 Silicon Nitride 의 合成(I)", "요업학회지" 25 (4) 415~423 (1988).
13. Charles P. Gazzara, Donald R. Messier, "Determination of Phase Content of Si_3N_4 by X-Ray Diffraction Analysis", "ceramic Bulletin", 56, (9) 777~780 (1977).
14. 森正章, 米屋勝利, 柏植章彦, 井上寛, "窒化ケイ素粉末", "セラミックス 17", (10) 834~840 (1982).
15. K. Kato, Z. Inoue, K. Kijima, I. Kawamata and H. Tanaka, "Structural Approach to the Problem of Oxygen Content in Alpha Silicon Nitride", "J.

- Am. Ceram. Soc.*, 58, 90-91 (1975).
16. K. Niihara, T. Hirai, "Rapid Chemical Vapor-Deposition of Si_3N_4 ", *J. Mater. Sci* 12, 631-632 (1977).
 17. 志儀, 忠輔, "窒化けい素(Si_3N_4)", ニューセラミック粉體ハンドブック, 226-235 (1983).
 18. A. J. Moulson, "Review, Reaction - Bonded Silicon Nitride: its Formation and Properties", *J. Mat. Sci* 14, 1017-1051 (1979).
 19. Soichiro Motoi, Shinichi Sasaki, "Effects of very Small Amounts of Components on the Nitridation of Silica-Carbon Mixtures", *Yogyo-Kyokai-shi* 85 (11) 537-542 (1977).
 20. P. Popper B. Sc, M. I. EE, A. Inst P, S. N. Ruddlesden, "The Preparation properties and Structure of Silicon Nitride", *Transactions of the British Ceramic Society*, 603-626 (1961).
 21. D. R. Messier, F. L. Riley and R. J. Brook, "The α/β Silicon Nitride Phase Transformation", *J. Mat. Sci* 13, 1199-1205 (1978).
 22. 成瀬旦, 野尻政春, 多田雅文, 窒化けい素の2結晶相の生成条件と性質について", 日本国金属学会志 第35卷 731-738 (1971).
 23. Yoshizo Inomata, "Stability Relationship in the System of $\beta-\text{Si}_3\text{N}_4 - \alpha\text{Si}_3\text{N}_4 - \text{Si}_2\text{N}_2\text{O}$ and their Structural Change by Heating above 1600°C", *Yogyo-Kyokai-shi* 82, (10) 522-526 (1974).